

氏名 米倉 健志

主論文審査の要旨

本研究は、MgB₂超伝導薄膜の輸送特性の向上およびその電力ケーブル応用を目指して、MgB₂超伝導薄膜の微細構造の制御を行い、磁束ピンニング特性を解析して、Al基板上MgB₂超伝導薄膜が電力ケーブルに応用できることを提案している。

本論文は、以下の6章により構成されている。

第1章では、研究の背景として、MgB₂超伝導薄膜の特徴、超伝導体の臨界電流密度の決定機構についてまとめ、MgB₂超伝導薄膜の電力ケーブル応用の有用性について述べている。

第2章では、MgB₂超伝導薄膜に膜面に対して平行な磁場が印加された時のJ_cの向上を試みている。電子ビーム蒸着法(EBE法)によりMgB₂層と数nmオーダーのNi層から成るMgB₂/Ni多層膜を作製した。Niは強磁性体であり、磁束線に対して有効なピンニングセンターとして作用して、膜面に対して平行な磁場に対して、臨界電流密度J_cが向上することを示した。

第3章では、基板にバッファ層を堆積させることでMgB₂の結晶性に変化させて、磁場中のJ_cを向上させることを試みている。MgB₂薄膜は分子線エピタキシー法(MBE法)によりエピタキシャル成長させて作製した。MBE法でTiバッファを堆積させた複数の基板上にMgB₂薄膜を作製したところ、結晶粒の大きさが変化することにより、高磁場中でJ_cが以前の研究で作製したMgB₂薄膜に比べ向上することを明らかにしている。

第4章では、MgB₂超伝導の電力ケーブル応用を目指して、無配向のAlテープ基板上にMgB₂薄膜をEBE法で作製した。MgB₂の組成比を化学量論的な場合とB過剰な組成比の場合の2種類の試料を作製した。これらの試料は、単結晶基板上にEBE法で作製したMgB₂薄膜と同等かそれ以上のJ_cを有していた。また、無配向基板でも単結晶基板上に作製した場合と同様に、結晶粒界がピンニングセンターとして作用していることを明らかにした。また、高磁場ではB過剰な試料が高いJ_cを有することを指摘している。

第5章では、Alテープ基板上MgB₂薄膜のさらなるJ_c向上を目指して、B過剰な組成のMgB₂薄膜について調査している。またBバッファ層を導入することで結晶性の改善も試みている。これらのMgB₂薄膜において、10K、自己磁場で10⁷A/cm²オーダーのJ_cを示した。以上より、Al基板上にMgB₂薄膜を作製することは線材作製法として有用であり、さらにバッファ層の導入などで特性を向上させることも可能であることを述べている。

第6章では、本研究のまとめと今後の課題を示している。

これらの研究成果はすでに、1件の国内の学術論文と3件の海外の学術論文誌に筆頭著者として掲載され、海外の学術論文誌に筆頭著者として1件投稿中となっている。また、他の論文として6件の海外学術論文を発表している。したがって、本論文は博士論文として学位授与に値するものと判断した。

審査委員 情報電気電子工学専攻 機能創成エネルギー講座 教授 藤吉 孝則
審査委員 情報電気電子工学専攻 機能創成エネルギー講座 教授 檜山 隆
審査委員 複合新領域科学専攻 複合新領域科学講座 教授 池上 知顯
審査委員 理学専攻 物理科学講座 教授 市川 聰夫